

Anexa nr. 9 la Contract nr. 10N/2016

Contractor: INCDFM

Cod fiscal : RO9068280

anexa la procesul verbal de avizare interna nr.

De acord,
DIRECTOR GENERAL
Dr. Ionut Enculescu

Avizat,
DIRECTOR DE PROGRAM
Dr. Lucian Pintilie

RAPORT DE ACTIVITATE AL FAZEI

Contractul nr.: 10N/10.03.2016

Proiectul PN16480102: Sinteză și caracterizarea materialelor nanostructurate, straturilor subtiri și heterostructurilor

Faza nr. 9: Efecte de interfata in structuri complexe feroelectric-feromagnetic

Termen: 12.08.2016

1. Obiectivul proiectului:

Prezentul proiect isi propune sa desfasoare studii detaliate privind sinteza materialelor multifunctionale, a nanomaterialelor si nanocompozitelor, a straturilor subtiri si heterostructurilor precum si caracterizari aprofundate privind proprietatile lor structurale, electrice, magnetice, optice, etc. cu scopul declarat de a identifica potentiile aplicatii de interes economic sau societal.

2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

Scopul este de a obtine noi cunostinte si de a dezvolta noi aplicatii in domenii de interes ridicat cum ar fi industriile de inalta tehnologie (electronica, optoelectronica, telecomunicatii, spatiu si securitate, senzoristica, auto, etc.), energetica (in special surse regenerabile si stocare) si medicina. Avand la dispozitie o infrastructura diversificata pentru depunerile de straturi subtiri, multistraturi si compositi complexe (PLD, pulverizare RF, diverse metode chimice, MAPLE, CVD, SPS), proiectul isi propune sa combine diverse materiale functionale, sub forma de straturi subtiri sau nano-obiecte, in arhitecturi complexe care sa duca la caracteristici imbunatatite sau la noi functionalitati derivate din diferite tipuri de cuplaje la interfete. Dintre materialele functionale se au in

vedere cele cu proprietati semiconductoare, dielectrice/ feroelectrice/ multiferoice/ piroelectrice/piezoelectrice si supraconductoare. Un accent aparte va fi pus pe durata in exploatare, cost redus, flexibilitate, abundenta naturala a elementelor constitutive si amprenta redusa asupra mediului inconjurator

3. Obiectivul fazei:

Se urmareste cum schimbarea stratului care joaca rol de electrod de baza in structuri complexe feroelectric-feromagnetic afecteaza proprietatile structurale, electrice si magnetice. Se au in vedere materiale feroelectrice de tip PZT sau BTO si ferite de tip CFO sau NFO. Ca substrat va fi folosit STO monocristalin, iar electroda de baza va fi SRO sau LSMO. Astfel de structuri pot prezenta proprietati fizice multiple precum multiferoicitate, cuplaj magnetoelectric, bistabilitate rezistiva.

4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

Pentru atingerea obiectivului se au in vedere urmatoarele: realizarea heterostructurilor epitaxiale de material feroelectric si material feromagnetic pe electrozi diferiti, utilizand ca metoda de depunere ablatia in fascicol laser pulsat; analiza structurala a heterostructurilor prin tehnici specifice cum ar fi difractia de raze X si microscopia electronica de transmisie; investigarea proprietatilor magnetice si electrice prin utilizarea unor metode specifice de masura (magnetometrie VSM si SQUID, masuratori de capacitate si impedanta, etc.). Datele obtinute vor fi utilizate la redactarea unei lucrari.

5. Rezumatul fazei: (maxim 5 pagini)

Introducere

In ultimii ani, unul dintre subiectele de interes stiintific crescut este reprezentat de sistemele multiferoice, in faza unica sau materiale composite, ce au cel putin doi parametrii de ordonare, ca de exemplu polarizare feroelectrica si magnetizare spontana, fiecare dintre acesti parametrii prezentand o curba de histerezis atunci cand probei i se aplica un camp extern electric sau respectiv magnetic [1], [2].

Materialele multiferoice compozite sunt studiate in special datorita valorilor mai mari ale coeficientilor de cuplaj magnetoelectric in comparatie cu cele obtinute in cazul materialelor in faza unica (ca de exemplu BiFeO_3) [3], [4]. Cateva tipuri de structuri de filme subtiri multi-strat au fost studiate de-a lungul timpului, acestea continand straturi alternativ feroelectrice (de exemplu $\text{Pb}(\text{Zr},\text{Ti})\text{O}_3$ (PZT) sau BaTiO_3 (BTO)) si feromagnetice (de exemplu CoFe_2O_4 (CFO) sau $\text{La}_x\text{Sr}_{1-x}\text{MnO}_3$ (LSMO)). Cresterea cuplajului magnetoelectric in astfel de structuri este explicat fie prin tensiuni mecanice ce apar la interfetele straturilor constituente (exemplu PZT/CFO) [5] fie prin efecte mediate de sarcini (exemplu heterostructurile PZT/LSMO) [6], [7]. Existenta interfetelor intre materiale cu proprietati diferite atat structurale cat si electrice/dielectrice sau magnetice, genereaza schimbari ale caracteristicilor structurilor multi-strat fata de cele ale materialelor constituente prin interactii mecanice (tensiuni in retelele cristaline ale filmelor), interactii electrostatice sau prin interactii de schimb magnetice.

Pentru acest studiu au fost depuse doua structuri tri-strat PZT/CFO/PZT pe substrat STO, folosind ca strat buffer si electrod de spate fie SRO fie LSMO. Proprietatile magnetice si cele dielectrice/ feroelectrice au fost analizate raportandu-se fie la proprietatile straturilor constituente fie la schimbarile structurale si electrostatice induse de schimbarea electrodului de spate.

Caracterizare structurala

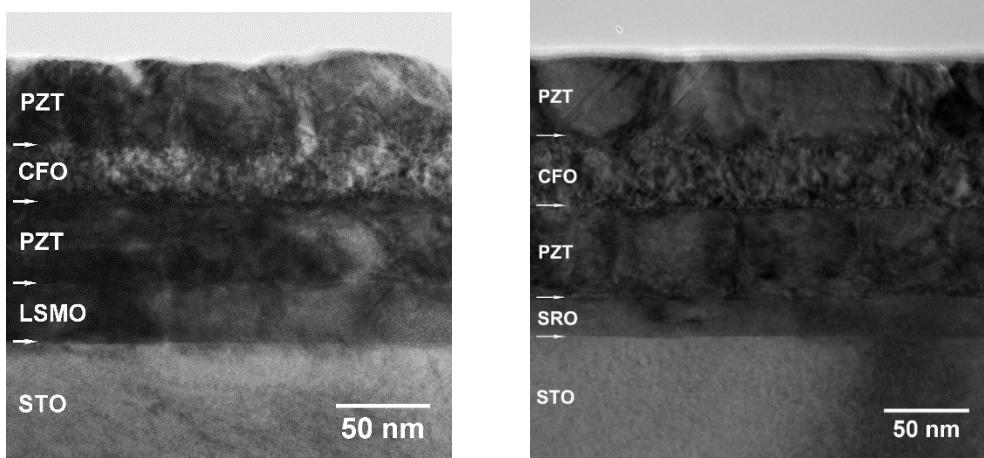


Figura 1 Imaginile TEM la marire mica ce evidenteaza heterostructurile
a)PZT/CFO/PZT/LSMO/STO si b) PZT/CFO/PZT/SRO/STO;

Imaginiile de microscopie TEM conventional (Fig.1 a) si b)) arata distributia si morfologia straturilor subtiri. Grosimea stratului de LSMO este de aproximativ 30nm, iar a stratului de SRO de 20nm. Pentru ambele structuri grosimile straturilor de PZT sunt de aproximativ 50nm, iar a stratului intermediar de CFO de aproximativ 30nm. Imaginile de difractie SAED (nu sunt prezente aici) confirma cresterea epitaxiala a tuturor straturilor depuse. Relatiile intre orientarile axelor cristalografice ale straturilor de PZT si CFO fata de substratul STO este urmatoarea: [011]STO || [011]PZT || [022]CFO. In cazul structurii PZT/CFO/PZT/LSMO/STO straturile subtiri au o densitate de defecte mai mare, iar interfetele si suprafata probei sunt mult mai rugoase.

Magnetism

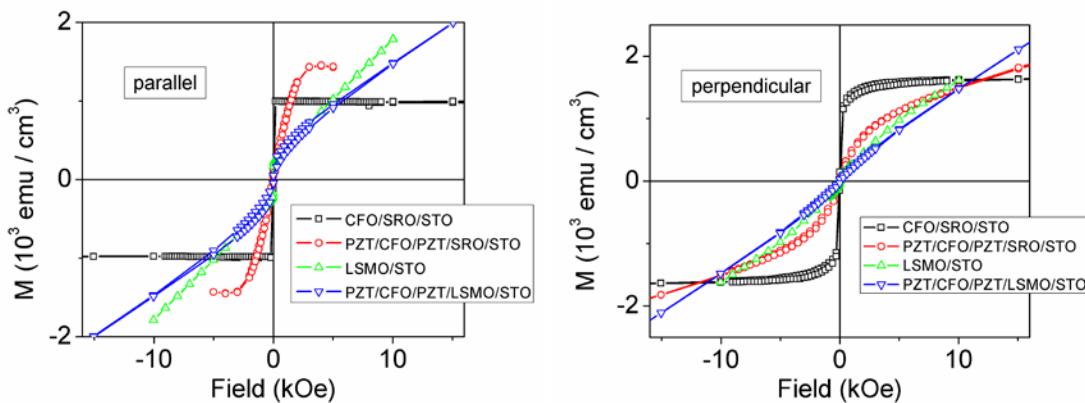


Figura 2 Curbele de histerezis (magnetizare in functie de camp magnetic aplicat) in geometrie paralela si perpendiculara

Proprietatile magnetice ale acestor structuri sunt evidențiate prin curbele de histerezis (Figura 2), pentru care a fost scăzuta componenta diamagnetica. Se obțin diferite valori ale campurilor

coercitive si diferite tendinte de saturare in functie de geometria de masura perpendiculara sau paralela, datorita existentei unor mecanisme de rotatie a spinilor precum si a anizotropiilor out-of plane diferite.

In geometrie paralela, magnetizarea structurilor CFO/SRO si PZT/CFO/PZT/SRO sunt saturate, avand o contributie semnificativa a filmul paramagnetic SRO. Magnetizarea de saturatie in cazul CFO/SRO este mai mica in comparatie cu cea a probei PZT/CFO/PZT/SRO, aratand ca momentul magnetic per unitate de formula a stratului de CFO este mai mic in primul caz (o structura de spin mai dezordonata). In cazul CFO depus pe LSMO, structura de spin pare sa fie mult mai dezordonata, la fel cum se observa si in cazul filmului de LSMO, spinii magnetici se reorientizeaza foarte greu in lungul directiei campului aplicat. Aceste observatii se pot interpreta fie presupunand ca o mare parte din atomii magnetici sunt in stare paramagnetica datorita interactiilor chimice locale, fie axe de usoara magnetizare sunt orientate aleator.

Filmul subtire de CFO depus direct pe stratul buffer SRO, prezinta o coercitivitate mai mare in comparatie cu restul probelor multistrat datorita proprietatilor structurale- apropiate de cazul ideal –structura de tip invers-spinel.

Caracterizarea electrica

In Figura 3 sunt prezentate curbele de histerezis a polarizarii in functie de tensiunea aplicata pentru heterostructura PZT/CFO/PZT depusa fie pe electrod de spate SRO fie LSMO. Curbele rectangulare obtinute demonstreaza proprietatea de ferroelectricitate. In cazul structurii depuse pe LSMO valoarea polarizarii remanente este $60 \mu C/cm^2$, iar in cazul structurii depuse pe SRO polarizare remanenta are valoarea de $90 \mu C/cm^2$.

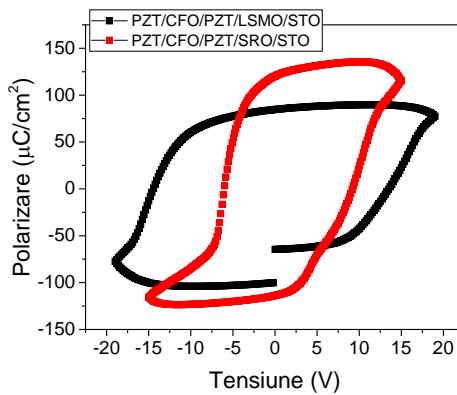


Figura 3 Curbele de histerezis ferroelectric inregistrate pe cele doua heterostructuri studiate

Figura 4 a) si b) prezinta comparativ pentru ambele structuri dependenta capacitatiei (C_p) si a pierderilor dielectrice ($\tan(\delta)$) in functie de frecventa, aceste rezultate putand fi comparate cu cele obtinute pe filme subtiri de PZT si CFO, depuse pe substrat STO cu electrod de spate SRO (Figura 4c) si d)). Pentru stratul PZT in faza unica, caracteristica dielectrica este specifica pentru un material ferroelectric: capacitatea are o mica variatie cu frecventa, iar pierderile dielectrice sunt mici [8]. In cazul stratului simplu CFO, de asemenea obtinem un comportament specific feritelor: capacitatea prezinta o variatie de aproximativ un ordin de marime atunci cand frecventa creste de la 100Hz la 1MHz, iar pierderile dielectrice prezinta o descrestere abrupta la frecvente mici, urmata de un maxim in jurul frecventei de 1kHz, apoi o crestere cu cresterea frecventei [9], [10]. Mecanismele de polarizare care influenteaza caracteristica dielectrica in acest interval de frecvente in cazul CFO sunt fie prezenta sarcinilor de conductie, zonele de saracire de sarcina

spatiale la interfata cu electrozii [9], fie procese de hopping a electronilor intre inonii de Fe^{2+} si Fe^{3+} in directia campului aplicat [11]. Se observa usor ca comportamentul dielectric a structurilor tri-strat este diferit fata de cel al straturilor in faza unica de PZT sau CFO. Desi caracteristicile dielectrice sunt influentate in special de prezenta stratului de CFO in comparatie cu stratul simplu de PZT (descresterea de tip “step-like” a capacitati si prezenta maximului in pierderile dielectrice), totusi acestea sunt puternic influntate de existenta interfetelor intre CFO si straturile PZT de rezistivitate mare (pierderile dielectrice sunt mult mai mici in comparatie cu cele ale filmelor in faza unica CFO). De asemenea, la frecvente mici, valoarea constantei dielectrice aproximata din valoarea capacitati masurate pentru structurile multi-strat este mai mare (220 la 100Hz in cazul electrodului de spate LSMO) in comparatie cu cea pentru PZT in faza unica (80-120 in functie de calitatea structurala [12]). Aceasta crestere a capacitati la frecvente mici este asociata cu existenta unei polarizarii interfaciale, datorata numarului mare de interfete intre materiale cu rezistivitate si permitivitate diferita [13]. Comportamentul dielectric al structurilor tri-strat este afectrat si de natura electrodului de spate. Astfel, in cazul electrodului de spate LSMO, densitatea de sarcini libere este mai mare in comparatie cu cazul structurii cu electrod de spate SRO (curenti de scurgere mai mari in primul caz), ceea ce explica cresterea valorilor pierderilor dielectrice in primul caz. Valorile crescute ale capacitati in cazul structurii depuse pe electrod de spate LSMO pot fi legate de diferențele structurale. Filmele de PZT depuse pe SRO prezinta in general o polarizare orientata catre suprafata superioara [14], asa cum probabil se intampla si in cazul primului strat de PZT din structura multi-strat depusa pe SRO. Aceste straturi pot avea un raspuns mai slab la campurile electrice aplicate, in comparatie cu cazul in care straturile de PZT sunt total relaxate (structura depusa pe LSMO).

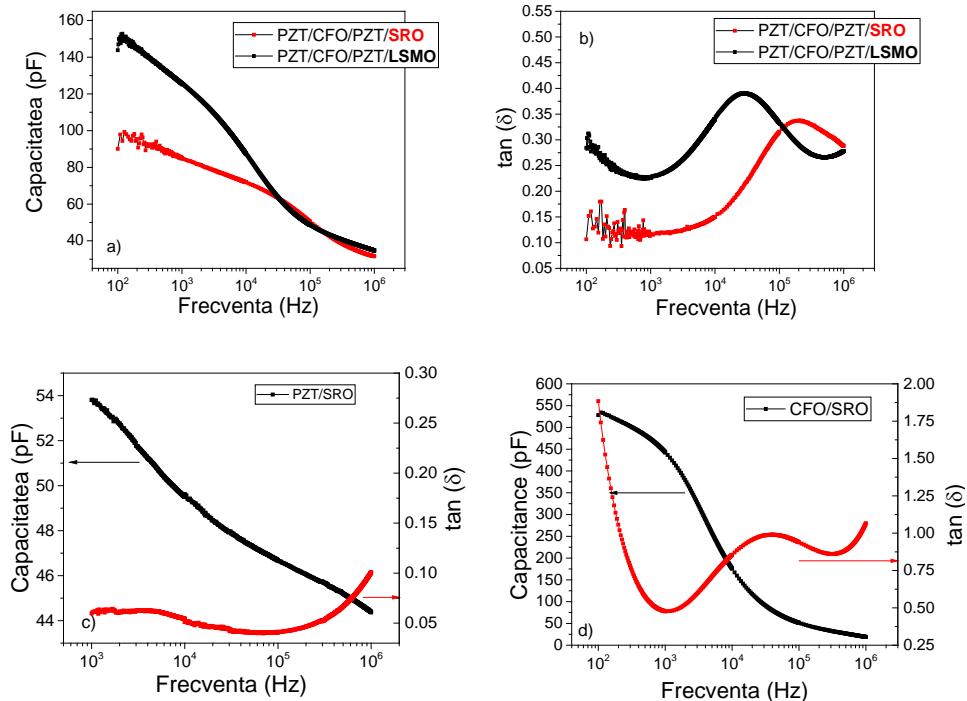


Figura 4 a) Caracteristica capacitate in functie de frecventa; b) dependenta pierderilor in functie de frecventa; c) caracteristica capacitate/pierderi in functie de frecventa pentru un strat de PZT; d) caracteristica capacitate/pierderi in functie de frecventa pentru un strat de CFO;

Pentru frecvențe mai mari de 50 kHz contribuția efectelor de interfata scade (relaxare), ramane doar răspunsul volumului, și se observă ca valorile capacităților este aproximativ egala pentru ambele structuri. Pentru frecvența de 100 kHz caracteristica capacitate-tensiune (C-V) a fost înregistrată pentru diferite temperaturi în intervalul 150K-400K. Comportamentul feroelectric este confirmat prin forma de tip fluture.

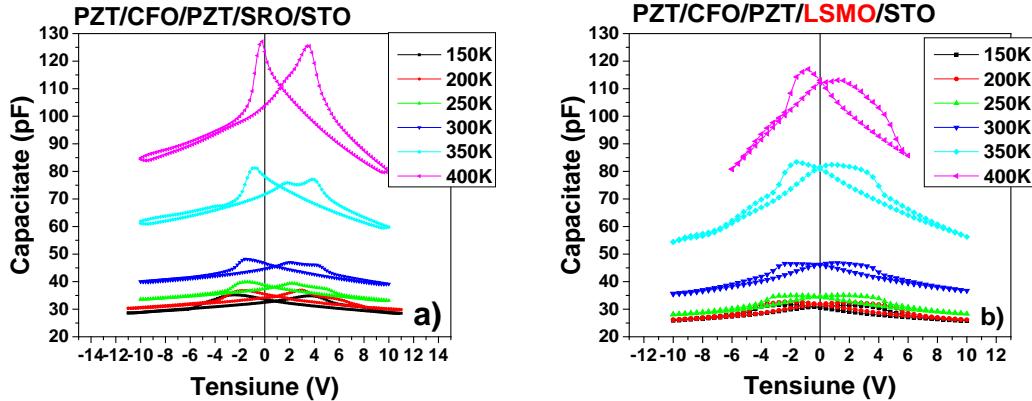
Pentru tensiuni mai mari ca tensiunea coercitivă, unde polarizarea este saturată și nu exsită reversare a polarizării, dependența capacității de tensiune este tipică unui contact Schottky [15], ceea ce înseamnă că reprezentarea $\frac{1}{C^2} = f(V)$ este liniară, iar din panta acestei reprezentări se obține densitatea de sarcini libere (generate de donori/acceptori și sarcini capturate pe nivele de captură). Astfel, în cazul structurii PZT/CFO/PZT depusă pe LSMO, N_{eff} calculat este aproximativ $2 * 10^{24} m^{-3}$ pentru ambele polarități iar în cazul structurii depuse pe SRO, densitatea efectivă de sarcină este $5 * 10^{25} m^{-3}$ și $8 * 10^{25} m^{-3}$ pentru tensiuni pozitive respectiv tensiuni negative. Aceste diferențe pot fi legate în special de calitatea structurală a straturilor de PZT.

În figura 5c) este reprezentată dependența constantei dielectrice în funcție de temperatura pentru ambele structuri. Se observă că pentru temperaturi mai mici de 300K, constanta dielectrică crește ușor cu creșterea temperaturii, pe când pentru temperaturi mai mari aceasta prezintă o creștere rapidă asociată cu descreșterea impedanței stratului de CFO (figura inset).

Pentru temperatură 300K, constanta dielectrică calculată pentru aceste structuri este aproximativ 60, ceea ce este o valoare mult mai mică în comparație cu cea a unui strat simplu de PZT. Acest rezultat este explicat dacă se consideră structurile ca fiind doi capacitori conectați în serie, unul

atribuit straturilor de PZT, iar celalalt stratului de CFO: $\frac{\epsilon}{d} = \frac{\frac{\epsilon_{PZT}}{d_{PZT}} * \frac{\epsilon_{CFO}}{d_{CFO}}}{\frac{\epsilon_{PZT}}{d_{PZT}} + \frac{\epsilon_{CFO}}{d_{CFO}}}$, unde $\epsilon = 60$ este

constantă dielectrică a structurii. $\epsilon_{PZT} = 120$, $\epsilon_{CFO} = 20$ [6] [8], $d_{PZT} = 100 nm$ grosimea straturilor de PZT, $d_{CFO} = 30 nm$ grosimea stratului de CFO.



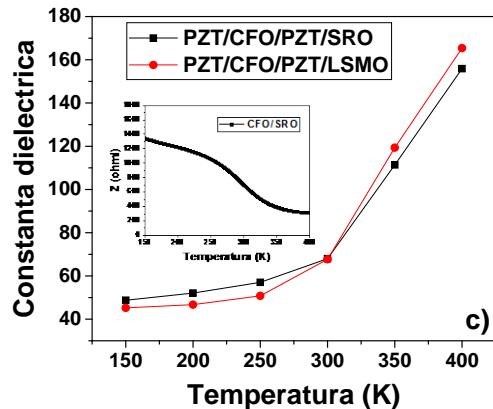


Figura 5 a)b) Caracteristica capacitate-tensiune pentru cele doua structuri studiate si c) dependenta constantei dielectrice in functie de temperatura pentru cele doua structuri (inset- dependenta impedantei in functie de temperatura pentru un strat de CFO)

Bibliografie

- [1] W. Eerenstein, N. D. Mathur, and J. F. Scott, “Multiferroic and magnetoelectric materials,” *Nature*, vol. 442, no. 7104, pp. 759–765, Aug. 2006.
- [2] M. Bibes and A. Barthélémy, “Multiferroics: Towards a magnetoelectric memory,” *Nat. Mater.*, vol. 7, no. 6, pp. 425–426, Jun. 2008.
- [3] L. W. Martin, S. P. Crane, Y.-H. Chu, M. B. Holcomb, M. Gajek, M. Huijben, C.-H. Yang, N. Balke, and R. Ramesh, “Multiferroics and magnetoelectrics: thin films and nanostructures,” *J. Phys. Condens. Matter*, vol. 20, no. 43, p. 434220, Oct. 2008.
- [4] M. Lorenz, V. Lazenka, P. Schwinkendorf, F. Bern, M. Ziese, H. Modarresi, A. Volodin, M. J. V. Bael, K. Temst, A. Vantomme, and M. Grundmann, “Multiferroic BaTiO₃–BiFeO₃ composite thin films and multilayers: strain engineering and magnetoelectric coupling,” *J. Phys. Appl. Phys.*, vol. 47, no. 13, p. 135303, Apr. 2014.
- [5] Z. Li, Y. Gao, B. Yang, Y. Lin, R. Yu, and C.-W. Nan, “Influence of Stress and Orientation on Magnetoelectric Coupling of Pb(Zr,Ti)O₃–CoFe₂O₄ Bilayer Films,” *J. Am. Ceram. Soc.*, vol. 94, no. 4, pp. 1060–1066, Apr. 2011.
- [6] C. A. F. Vaz, J. Hoffman, Y. Segal, J. W. Reiner, R. D. Grober, Z. Zhang, C. H. Ahn, and F. J. Walker, “Origin of the Magnetoelectric Coupling Effect in PbZr_{0.2}Ti_{0.8}O₃/La_{0.8}Sr_{0.2}MnO₃ Multiferroic Heterostructures,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 104, no. 12, p. 127202, Mar. 2010.
- [7] J. M. Rondinelli, M. Stengel, and N. A. Spaldin, “Carrier-mediated magnetoelectricity in complex oxide heterostructures,” *Nat. Nanotechnol.*, vol. 3, no. 1, pp. 46–50, Jan. 2008.
- [8] C. S. Hwang, B. T. Lee, C. S. Kang, K. H. Lee, H.-J. Cho, H. Hideki, W. D. Kim, S. I. Lee, and M. Y. Lee, “Depletion layer thickness and Schottky type carrier injection at the interface between Pt electrodes and (Ba, Sr)TiO₃ thin films,” *J. Appl. Phys.*, vol. 85, no. 1, pp. 287–295, Jan. 1999.
- [9] D. Gutiérrez, M. Foerster, I. Fina, J. Fontcuberta, D. Fritsch, and C. Ederer, “Dielectric response of epitaxially strained CoFe₂O₄ spinel thin films,” *Phys. Rev. B*, vol. 86, no. 12, p. 125309, Sep. 2012.
- [10] A. M. M. Farea, S. Kumar, K. M. Batoo, A. Yousef, C. G. Lee, and Alimuddin, “Structure and electrical properties of Co_{0.5}CdxFe_{2.5-x}O₄ ferrites,” *J. Alloys Compd.*, vol. 464, no. 1–2, pp. 361–369, Sep. 2008.

- [11] K. Iwauchi, “Dielectric Properties of Fine Particles of Fe₃O₄ and Some Ferrites,” *Jpn. J. Appl. Phys.*, vol. 10, no. 11, pp. 1520–1528, Nov. 1971.
- [12] I. Vrejoiu, G. Le Rhun, L. Pintilie, D. Hesse, M. Alexe, and U. Gösele, “Intrinsic Ferroelectric Properties of Strained Tetragonal PbZr0.2Ti0.8O₃ Obtained on Layer-by-Layer Grown, Defect-Free Single-Crystalline Films,” *Adv. Mater.*, vol. 18, no. 13, pp. 1657–1661, Jul. 2006.
- [13] A. R. V. Hippel, *Dielectrics and Waves*. Boston; London: Artech House Print on Demand, 1995.
- [14] L. Pintilie, C. Ghica, C. M. Teodorescu, I. Pintilie, C. Chirila, I. Pasuk, L. Trupina, L. Hrib, A. G. Boni, N. Georgiana Apostol, L. E. Abramiec, R. Negrea, M. Stefan, and D. Ghica, “Polarization induced self-doping in epitaxial Pb(Zr0.20Ti0.80)O₃ thin films,” *Sci. Rep.*, vol. 5, p. 14974, Oct. 2015.
- [15] S. M. Sze, *Physics of Semiconductor Devices*, 2nd edition. John Wiley & Sons.

6. Rezultate, stadiul realizării obiectivului fazei, concluzii și propuneri pentru continuarea proiectului (se vor preciza stadiul de implementare a proiectului, gradul de indeplinire a obiectivului cu referire la tinte stabilite și indicatorii asociati pentru monitorizare și evaluare).

Toate activitatile propuse in aceasta faza de nucleu au fost derulate, iar obiectivul fazei a fost atins. Un articol cu titlul „The influence of the bottom electrod on structural, electric and magnetic properties of PZT-CFO-PZT multilayered structure” pe acest studiu este in elaborare, ce va fi trimis catre un jurnal cotat ISI.

Responsabil proiect

Dr.Adrian Crisan

Responsabil faza

Dr.A.Boni, Dr.L.Hrib, Dr.ChirilaL.Pintilie